

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-133646

(43)Date of publication of application: 16.07.1985

(51)Int.CI.

H01J 37/08 H01J 27/16

(21)Application number : 58-239753

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

21.12.1983

(72)Inventor: KOIKE HIDEMI

SAKUMICHI KUNIYUKI TOKIKUCHI KATSUMI SEKI TAKAYOSHI OZASA SUSUMU

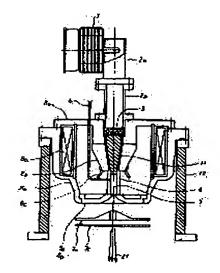
OKADA OSAMI

(54) MICROWAVE ION SOURCE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the occurrence of unusual discharges in the space where to take out the ion beam from and make it possible to generate a magnetic field field in the discharge chamber with a low electric power by placing a permanent magnet or an electromagnet to generate a magnetic field in the discharge chamber at a position of the same potential as that of the discharge chamber.

CONSTITUTION: Using a magnetic field generator consisting of a solenoid coil 8a, a magnetic path 8b made of pure iron, and an auxiliary magnetic pole 8c to control the magnetic field distribution in a discharge chamber 5, which are all installed to surround the discharge chamber 5, the magnetic field is applied in such a direction as to intersect the microwave electric field at right angles. In this state, a gas to be ionized is taken into the discharge chamber 5 through a gas intake pipe 6, and the plasma is generated through the interaction of the microwave electric field and the magnetic field which



have been formed in the discharge chamber 5, and an ion beam 21 is taken out from the plasma by an ion beam take-out electrode system 7a, 7b, 7c. In this way, the magnetic field can be kept from leaking into the space where to take out the ion beam from, and unusual discharges can be decreased and an electric power to be supplied to a magnetic field generator can also be reduced.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or 卿日本国特許庁(IP)

① 特許出顧公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 133646

@Int_CI.4

3

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)7月16日

H 01 J 37/08 27/16

7129-5C 6680-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

マイクロ波イオン源

2)特 願 昭58-239753

願 昭58(1983)12月21日

砂発 明 者 池 英 E

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

明 訓之 四発 老 道

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

72発 明 者 登木口 克己 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

何発 明者

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

勿出 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

10代理人 弁理士 高橋 外1名

最終頁に続く

専明の名称 マイクロ波イオン源

特許請求の範囲

1. マイクロ波による電界と、永久磁石あるい は電磁石で発生した磁界とを作用させて作られた プラズマからイオンを引き出すマイクロ波イオン 顔において、上記磁界を発生させるための永久磁 石あるいは電磁石を、プラズマを形成する放電室 と同電位の位置に置くことを特徴としたマイクロ 波イオン源。

2. 上記永久磁石あるいは電磁石を囲むように、 高透磁率部材で磁路を形成し、上記放電室の近傍 にのみ磁界が発生するようにすることを特徴とす る特許請求範囲第1項記載のマイクロ波イオン派。

3. 上記磁路の先端に、上記放電室内部の磁場 分布を制御するための補助磁便を取付けたことを 特徴とする特許請求の範囲第2項記載のマイクロ 波イオン源。

発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明は、mA級のイオンビームを引き出せる イオン源に係り、特に大電流イオン打込み装置に 好適なイオン源に関する。

[発明の背景]

第1図に従来のマイクロ波イオン源の構成を示 す。従来は、放電室5内に磁界を発生させるため の空心ソレノイドコイル 8 がアース電位の位置に 置かれ、放覧室の覧位は引き出されるイオンビー ムの加速電圧と同電位に置かれていたため、イオ ンピーム21を引き出すための電界のかかったや 間にも磁界が存在し、この空間で、引き出し電板 間の異常放電が発生しやすいという欠点があった。 また、放電室5と空心ソレノイドコイル8は電気 的に絶縁 (例えば耐電圧80KV) する必要があ るため、大きく離れた位置に置かなければならな かった。そのため、空心ソレノイドコイル8は大 きくならざるを得ず、印加する電力も大きいとい う欠点があった。

【本発明の目的】

本発明の目的は、イオンピームを引き出す空間

特開昭60-133646(2)

での異常放電が発生しにくく、さらに、放電室に 発生させる磁界を低電力で発生できるマイクロ波 イオン顔を提供することにある。

(発明の概要)

イオンビームを引き出す空間に磁界を存在させ ないごと、また、磁界発生器を放電室の近くに持 ってくることが、上記目的の解決策となる。本発 ・明では、放電室に磁界を発生させるための永久磁 石あるいは電磁石を放電室と同電位の位置に置き、 さらに、放電室の近傍にのみ磁界が発生し、イオ ンピームを引き出す空間には磁界が発生しないよ う、高透磁率部材の磁路で放電室の周りを照んだ。 [発明の実施例]

本発明の一実施例を第2図により説明する。マイ クロ波イオン版は、マイクロ波発生器1, 導波管 2, マイクロ波導入フランジ3, 放電室5, ガス・ 進入管6、磁界発生器8、イオンピーム引き出し 電極系フで構成されている。同因において、マイ クロ波発生器1で発生したマイクロ波は、矩形導 波管 2 a , 2 b 、マイクロ波導入フランジ 3 を 稿

以上のように、本発明によれば、イオンビーム 引き出し空間での異常放電を少なくするとともに 磁界発生器に投入する電力をも少なくすることが できる.

図面の簡単な説明

第1図は、従来のマイクロ波イオン顔の構成を 示す断面図、第2図は、本発明によるマイクロ波・ イオン源の一実施例を示す断面図である。

1 … マイクロ波発生器、2 a, 2 b … 矩形導波管、 3 …マイクロ波導入フランジ、4 … 放電電極、5 …放電室、6…ガス導入管、7a,7b,7c… イオンピーム引き出し電極系、8,88…ソレノ イドコイル、8 b…磁路、8 c…補助磁極、11 … 放電電極内に放電室を形成するための誘電体充 填物、12… 稻稌碍子。

代理人 弁理士 髙 橋 明 夫

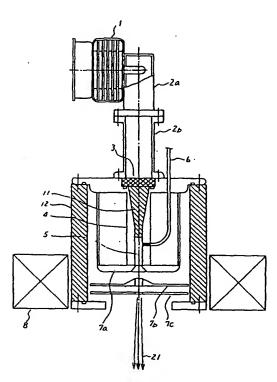


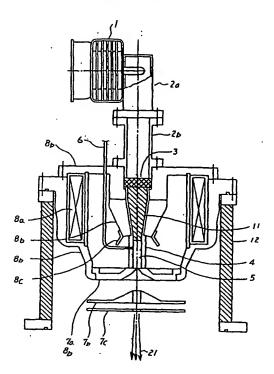
由して放電室、5 に導入され、放電室 5 内にマイク 口波電界を発生させる。さらに、放電室付近には、 放電室5を囲むように置かれた、ソレノイドコイ ル8 a、純鉄製の磁路8b、放電室5内の磁場分 布を制御するための補助磁極8cからなる磁界発 生器により、マイクロ波電界を直交する方向に磁 界が印加される。この状態で、イオン化すべきガ スをガス導入管6より放電室5内に導入し、放電 室 5 内に形成されているマイクロ波電界と磁界と の相互作用で、プラズマを発生させ、イオンビー ム引き出し電極系フォ,フb,フcにより、上記 . ブラズマからイオンビーム21が引き出される。

本実施例によれば、イオンビーム引き出し空間 . への磁界の洩れを数ガウス以下(放電室内600 ガウス時)におさえることができ、80KVでの イオンビーム引き出しが容易に行なえるようにな った。また、ソレノイドコイルに印加する電力も、 従来1200W位必要であったのに対し、300 W以下で済むようになった。

(発明の効果)







第1頁の続き

砂発 明 者 小 笹 進 国分寺市東恋ケ窪 1 丁目 280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

②発 明 者 岡 田 修 身 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内